

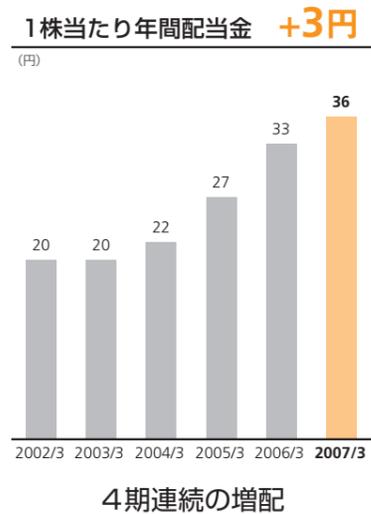
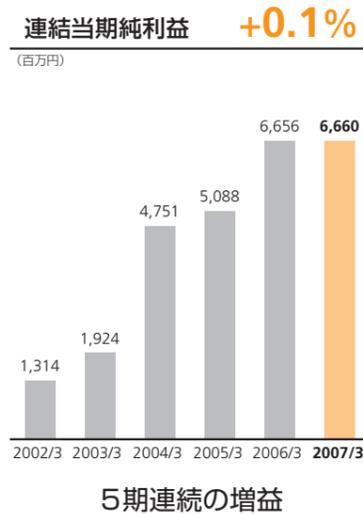
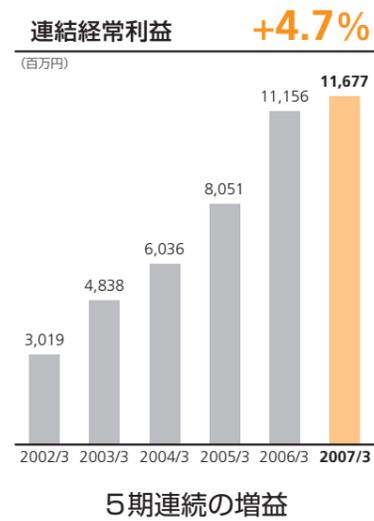
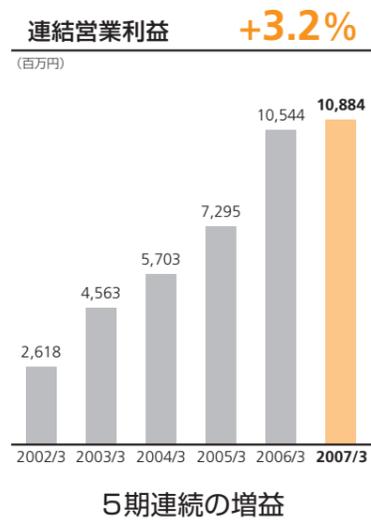
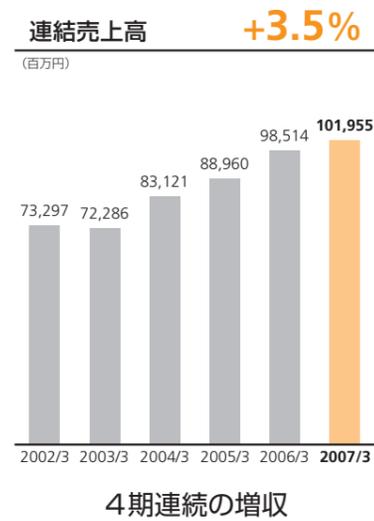
EXPANDING SCOPE OF NEW CHALLENGES

▶▶ アニュアルレポート 2007

2007年3月期



tok 東京応化工業株式会社



CONTENTS

プロフィール	1	財務セクション	14
持続的な企業価値の拡大を目指して	2	・6年間の要約財務データ	14
社長メッセージ—新たな成長ステージへの歩み	3	・業績および財政状態の分析	15
特集：持続的な企業価値の拡大に向けて、3つの基本戦略を推進	6	・連結貸借対照表	18
1. 微細加工技術の進化	7	・連結損益計算書	20
2. グローバル市場でのTOKブランドの確立	11	・連結株主資本等変動計算書	21
3. 経営体質の強化・企業風土改革	12	・連結キャッシュ・フロー計算書	22
		TOKグローバルネットワーク	23
		会社情報	24
		株式の概況	25

東京応化は、1940年の設立以来、「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」「社会への貢献」「自由闊達」の経営理念の下、エレクトロニクス機能材料をはじめとする材料事業や装置事業の技術・製品の提供を通じて、社会の進歩・発展に貢献してきました。

今後も、調和のとれた未来の創造に向けて“モノづくり”を進めると同時に、CSR(企業の社会的責任)を意識した企業活動を展開し、持続的な企業価値の拡大を実現させ、ステークホルダーの皆様から高い信頼と満足を寄せられる魅力ある企業であり続けたいと考えています。

■材料事業

●エレクトロニクス機能材料

半導体やフラットパネルディスプレイ、半導体パッケージ/実装、プリント基板等の微細加工に必要な不可欠な材料として広く使用されているフォトレジスト※や、半導体の微細化の進展に伴う配線の多層化に対応し層間絶縁膜・平坦化絶縁膜として用いられる被膜形成用塗布液等を提供しています。当社グループは、より高性能・高品質な製品を開発し供給することで、エレクトロニクス産業発展の一翼を担っています。

※フォトレジスト：光に反応して化学的に作用・変化する樹脂で、感光性樹脂とも呼ばれています。



49.6%

●高純度化学薬品

フォトレジストの総合メーカーとして、その特性を熟知しているアドバンテージを生かし、現像液、剥離液、リンス液、シンナー等のフォトレジスト付属薬品も幅広くラインナップしています。さらに、様々な産業分野で利用されている無機・有機化学薬品も取りそろえています。



27.1%

●印刷材料

飲料缶や段ボール、フィルム等の凸版印刷に用いられる感光性樹脂版のほか、オフセット印刷に使われるPS版等、幅広く印刷製版材料を提供しています。環境に配慮したフレキソ印刷用感光性樹脂版の開発・改良を積極的に進め、印刷工程における合理化・無公害化・高品質化等のニーズにお応えしています。



4.5%

■装置事業

●プロセス機器

液晶パネル製造用のフォトレジスト塗布・現像装置や、各種半導体製造用装置を取りそろえています。これらの装置とフォトレジストをはじめとする材料の両面から製品開発を行い、相乗効果を最大限に引き出すことで、お客様をサポートしています。



18.6%

(注) 写真左横の数字は連結ベースの売上構成比率です。また、装置事業につきましては、内部売上高を除いています。

高いCSR(企業の社会的責任)意識の下、
顧客満足に徹し、
技術の進化と人材開発に挑戦し、
継続的に利益の出せる会社を構築します。



取締役社長
中村 洋一

→ 2007年3月期の経営成績

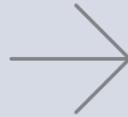
連結売上高は4期連続の増収で
初めて1千億円を突破、
利益面でも5期連続の増益を達成

中期計画第3次「tokチャレンジ21」の初年度となる当期(2007年3月期)の事業環境を振り返りますと、半導体市場は、デジタル家電や情報関連機器のほか、自動車等へ半導体の用途拡大が進み堅調に推移しましたが、フラットパネルディスプレイ(FPD)市場は、薄型テレビ等への需要拡大は見られなかったものの、販売価格の下落や液晶パネルの生産調整の影響を受け厳しい状況となりました。

このような状況の下、材料事業では、半導体製造分野において、需要の拡大に加え、ユーザーニーズに対応した販売活動が奏功し、エキシマレーザー用フォトレジスト等の最先端材料を中心に実績を伸ばしました。また、FPD製造分野では、下期に液晶パネルの生産調整の動きが急速に広がり、計画を下回る実績となりましたが、国内外の生産拠点の整備を進め生産能力の向上と製造コストの削減を図り、高付加価値製品の販売が拡大したことにより、通期では前期を上回る実績をあげることができました。一方、装置事業は、液晶パネルメーカーの設備投資抑制の影響から当期の受注は前期を下回りましたが、豊富な受注残高に支えられ過去最高の売上高を計上することができました。

この結果、当期の連結経営成績は、売上高は1,019億55百万円(前期比3.5%増)と4期連続の増収を達成し、初めて1千億円を超える過去最高の実績をあげることができました。利益面では、営業利益は108億84百万円(同3.2%増)、経常利益は116億77百万円(同4.7%増)、当期純利益は66億6千万円(同0.1%増)となり、いずれも5期連続の増益となりました。なお、営業利益率は10.7%、経常利益率は11.5%となりました。

当期の期末配当金につきましては、前期に実施しました記念配当3円を普通配当として継続し、1株当たり18円とさせていただきます。これにより、中間配当金と合わせて、年間配当金は前期と比べ1株当たり3円増配の36円となり4期連続の増配となりました。



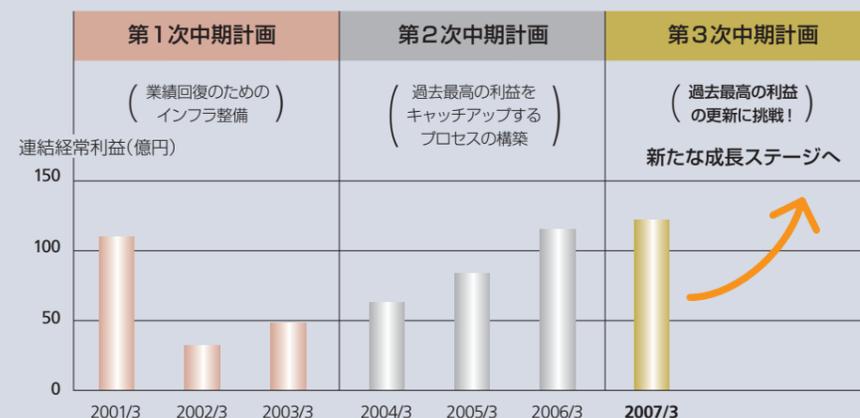
中期計画第3次「tokチャレンジ21」の進捗状況

過去最高の利益の更新を目指し、 技術開発力とブランド力を強化

2006年4月にスタートした中期計画第3次「tokチャレンジ21」では、「高いCSR(企業の社会的責任)意識の下、顧客満足に徹し、技術の進化と人材開発に挑戦し、継続的に利益の出せる会社を構築する」ことをスローガンに掲げ、「微細加工技術の進化」「グローバル市場でのTOKブランドの確立」「経営体質の強化・企業風土改革」を基本戦略として、過去最高の利益(1998年3月期:連結経常利益136億円)の更新を目指します。

「微細加工技術の進化」につきましては、半導体製造分野で、競合他社に先駆けて導入した液浸プロセスに対応する露光装置を活用し、各種材料やプロセス技術の開発を加速させるなど次世代以降の研究開発を推進するとともに、FPD製造分野でも、高度化・多様化するユーザーニーズに対応する環境を整えるため、当分野に特化した研究開発棟の建設を行うなど将来を見据えた諸施策を講じてきました。さらに、新規事業領域の創出を指向し、環境負荷の少ないエネルギー源として期待される太陽電池分野での研究開発を進めるなど、次世代に継承できる新たな事業領域の開拓にも注力しています。

「グローバル市場でのTOKブランドの確立」につきましては、微細加工技術における優位性を堅持すべく注力する一方、半導体用フォトレジストで培った強いブランド力を既存の他事業に展開し、さらに、微細加工技術分野のリーダーとしてグローバル市場における確固たる地位を築くために、これまで整備してきた海外の製造・販売拠点を有効活用し、品質、価格、性能、技術支援等の総合的な観点から顧客満足度のより一層の向上に努めています。



「経営体質の強化・企業風土改革」につきましては、経営を取り巻く事業環境の変化に対応するため、内部統制システムの構築、コンプライアンスやリスク管理の強化に努めるほか、環境の変化に柔軟に対応できる人材の育成と組織の実現に取り組んでいます。

しかしながら、装置事業の事業環境が厳しくなっていること、また、積極的な設備投資および会計処理基準の変更等に伴い減価償却費が増加することなどを勘案すると、先行きは楽観を許さず、次期(2008年3月期)の業績につきましては、売上高は増加するものの、利益面では減益を余儀なくされるものと予想されます。

したがって、第3次中期計画の策定当時に設定した最終年度(2009年3月期)の数値目標を達成するには、業績向上のさらなるペースアップが必要となりますが、本中期計画のコンセプトの1つである「過去最高の利益の更新」は、新たな成長ステージへと歩を進めるための重要な経営目標であると認識し、その達成に向けて最善を尽くす所存です。



ステークホルダーの皆様へ

持続的な企業価値の拡大に向けて

当社グループは、微細加工技術を追求するプロセスにおいて、同分野に対して積極的に経営資源を投入してきましたが、これからもその手を緩めることなく、必要な研究開発および設備投資を強力に推進していきます。それこそが、将来における収益の源泉となり、さらには「持続的な企業価値の拡大」につながるものと確信しているからであります。当期の業績も、過去数年間にわたる研究開発および設備投資が結実したものです。今後も数年、あるいは数十年先の未来を見据えて、継続的かつ積極的に取り組んでいく覚悟です。

ステークホルダーの皆様には、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2007年8月

取締役社長

中村洋一

▶▶ 特集：持続的な企業価値の拡大に向けて、3つの基本戦略を推進

→ 持続的な企業価値の拡大へ

過去最高の利益の更新に挑戦

新たな成長ステージへの道筋を描いた中期計画第3次「tokチャレンジ21」では、「微細加工技術の進化」「グローバル市場でのTOKブランドの確立」「経営体質の強化・企業風土改革」の3つの基本戦略の下、過去最高の利益の更新に向けた取り組みを推し進めています。

微細加工技術を核とする最先端技術領域での研究開発を積極的に行い、高い信頼感を有する「TOKブランド」の確立に努めると同時に、CSR(企業の社会的責任)を強く意識した企業活動を展開し、持続的な企業価値の拡大を目指します。

「tokチャレンジ21」の基本的な考え方



1. 微細加工技術の進化
— 微細加工技術の未来を見つめて

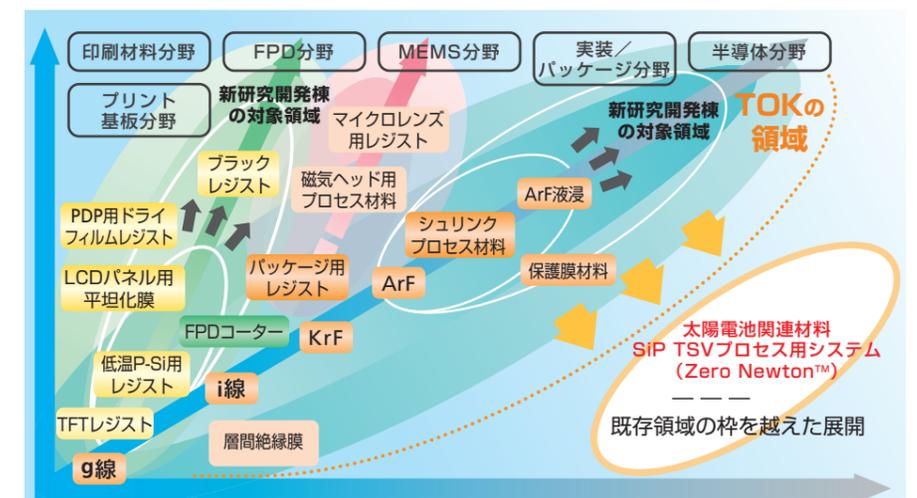
「微細加工技術の進化」は持続的な成長の原動力

当社グループは、急速な技術革新を続けるエレクトロニクス業界で競争力を維持するため、微細加工技術を愚直なまでに追求してきました。それは、微細加工技術が当社グループにとってコアコンピタンスであり、企業価値を生み出す本源であるからにほかなりません。

第3次中期計画では、新たな成長ステージへ歩を進めるため、「微細加工技術の進化なしに持続的な成長は実現し得ない」という認識の下、ユーザーニーズを的確に捉えた競争力のある新技術・新製品の開発に取り組んでいます。

微細加工技術の“垂直的展開”として、技術を複合的に組み合わせ、より付加価値の高い微細化の提案を行う一方、“水平的展開”として、既存技術の応用と現状にとらわれない発想の転換により、これまでの事業領域の枠を越え、将来の事業の中核を担う次世代ビジネスの開拓にも注力し、さらなる「微細加工技術の進化」に挑戦していきます。

微細加工技術の進化

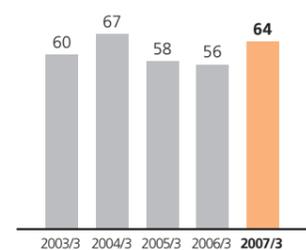


TSV : Through Silicon Via (貫通電極)

2007年3月期に業績を牽引した製品

当期(2007年3月期)は、半導体製造分野では、KrFエキシマレーザー用フォトレジストが材料事業の業績を牽引し、ArFエキシマレーザー用フォトレジストも売上の増大に伴い徐々に存在感を増してきました。また、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造分野でも、液晶TFTアレイ用フォトレジスト、液晶カラーフィルター用ブラックレジストが、下期こそ厳しい展開を余儀なくされましたが、売上を伸ばすことができました。さらに、装置事業では、豊富な受注残高を背景に、液晶カラーフィルター用塗布装置が堅調に推移し収益に貢献しました。

研究開発費の推移(連結) (億円)



研究開発

最先端分野における微細加工技術の優位性を堅持し、将来にわたり持続的な成長を遂げるための生命線が研究開発です。経営資源を積極的かつタイムリーに投入することでより一層の技術開発力の強化を図り、また、独自の研究開発体制の整備はもちろん、装置メーカー、サプライヤー、大学や研究機関等との連携も積極的に進めています。

既存事業領域におけるさらなる競争力の向上を図ると同時に、新規事業領域の創出にも鋭意努力し、“微細加工技術の未来”を見据えた取り組みを展開しています。

主な研究開発の成果

- 2005年**
- SiP TSV (Through Silicon Via:貫通電極)プロセス用ウェハハンドリングシステムを三洋電機様と共同開発
 - ⇒薄化LSIチップと貫通電極を組み合わせた3次元実装技術に対し、材料・装置の両面から独自のソリューションを提供。
 - ① ナノ加工精度を向上させるナノコーティング材料を開発
- 2006年**
- 太陽電池関連材料分野に参入
 - ⇒環境負荷の少ないエネルギー源として期待される太陽電池分野で、発電効率の向上を可能にする材料(拡散剤)を開発。
 - ② 極端紫外線(EUV)リソグラフィ用低分子フォトレジスト材料を開発

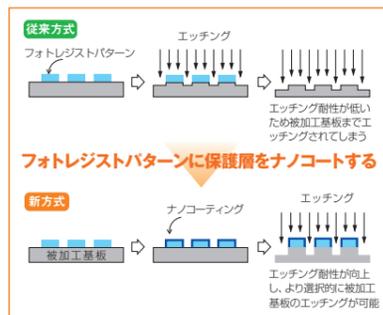
① ナノコーティング材料

半導体製造プロセスでは、回路線幅のパターンの微細化に伴いフォトレジスト膜の薄膜化が進み、必然的にエッチング耐性が低下するという技術的課題が生じています。

この課題に対し、独立行政法人理化学研究所様と共同で、わずか数ナノメートル(nm)の厚みの保護膜をフォトレジストの上に形成することで、従来に比べてエッチング耐性を10倍以上高める保護膜コーティング剤ならびにそれに対応したプロセスの開発に成功しました。

開発した新方式は、フォトレジストパターンを形成した後に保護膜コーティング剤を塗布することで、保護膜形成剤の化学吸着によりパターン表面に数nmの保護膜を形成させ、その薄膜にエッチング時の浸食からフォトレジストを保護する役割を持たせるというものです。

この技術は、さらなる微細化プロセスの高度化に大きく寄与できるものと考えています。



② 極端紫外線(EUV)リソグラフィ用低分子フォトレジスト材料

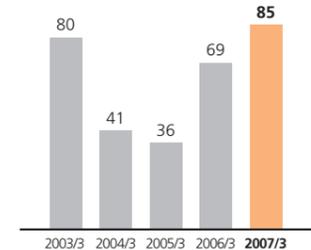
(株)日立製作所様との共同開発、また、技術研究組合 超先端電子技術開発機構(ASET)様の協力を得て、EUVリソグラフィ用フォトレジストの基本材料として、分子量1,000程度(従来の高分子は分子量約10,000程度)の新規低分子ポリフェノールを開発しました。この“均一で小さな分子”を採用し最適化したことにより、大きな課題とされていたLER*の低減を可能にしたうえ、必要な高解像度と生産性に直結する高感度を達成することに成功しました。

このフォトレジスト材料が、2012年頃と予想されるハーフピッチ(hp)32nm世代以降のEUVリソグラフィに求められている超微細加工を可能にするものと期待されています。

*フォトレジストの壁面にできる凸凹(粗さ)をLER(Line-Edge Roughness)と呼び、この凸凹の大きさは、配線の断線、ショート等を引き起こし、半導体デバイスの生産性に多大な影響を与えます。



設備投資額の推移(連結) (億円)



設備投資

持続的な成長を確かなものとするため、必要な設備投資を積極的に行っています。研究開発のスピードや精度を一層高めるとともに、品質管理・品質保証体制をさらに強化する目的で、半導体製造分野およびFPD製造分野でそれぞれ専用の研究開発棟を新設したほか、国内外で生産体制の整備を進めています。

主な設備投資

- 2005年**
- 液晶カラーフィルター用ブラックレジストの生産能力を増強
 - 中国の合弁会社CHANG CHUN TOK(CHANGSHU) CO., LTD.で半導体・液晶ディスプレイ製造用高純度化学薬品の商業生産を開始
- 2006年**
- ① 新研究開発棟(半導体製造分野)が竣工、運用を開始
 - 韓国 合弁会社COTEM CO., LTD.で液晶TFTアレイ用フォトレジストの現地生産を開始
- 2007年**
- ② 新研究開発棟(FPD製造分野)が竣工

① 新研究開発棟(半導体製造分野)

半導体製造プロセスにおける微細化の進展に対応するため、2006年2月、相模事業所内に最先端半導体製造用材料の研究開発棟を竣工させ、2006年7月に運用を開始しました。新研究開発棟は、清浄度の高いスーパークリーンルームのほか、フォトレジストメーカーとして世界で初めて導入した液浸露光対応のArFエキシマレーザー露光装置等、300mmウェハ対応の最新鋭の研究開発機器を備えています。さらに、次期(2008年3月期)には、最先端の高開口度(NA)ArFエキシマレーザー露光装置(ドライブプロセス)を導入予定です。

半導体製造分野での研究開発を当社グループの微細加工技術の“フラッグシップ”と位置づけ、次世代の技術領域でイニシアティブを握り、微細加工技術における優位性を確固たるものとすべく取り組んでいます。



新研究開発棟(半導体製造分野)



スーパークリーンルーム内部

② 新研究開発棟(FPD製造分野)

2007年4月、相模事業所内にFPD製造分野に特化した新たな研究開発棟を竣工させました。特に液晶向けは、大型ガラス基板に対応した研究開発機器および評価設備を導入することにより、ユーザーニーズに合った製品開発に取り組んでいきます。

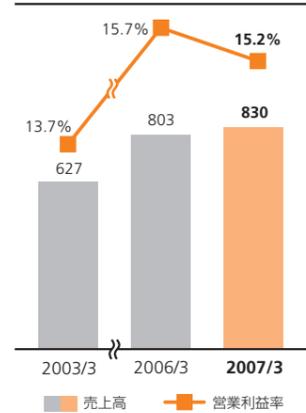


新研究開発棟(FPD製造分野)

事業別の活動状況

当社グループの事業は、材料事業と装置事業の2つのセグメントから構成されています。それぞれの事業において、ますます高度化する市場のニーズに応えるため一層の技術開発力の強化を図るとともに、戦略的な新規顧客の開拓にも努めています。

材料事業の業績推移(連結) (億円)



材料事業

各分野の先端領域で、エレクトロニクス機能材料を中心に「微細加工技術の進化」を図るとともに「TOKブランド」の確立にも取り組み、事業の拡大に努めています。

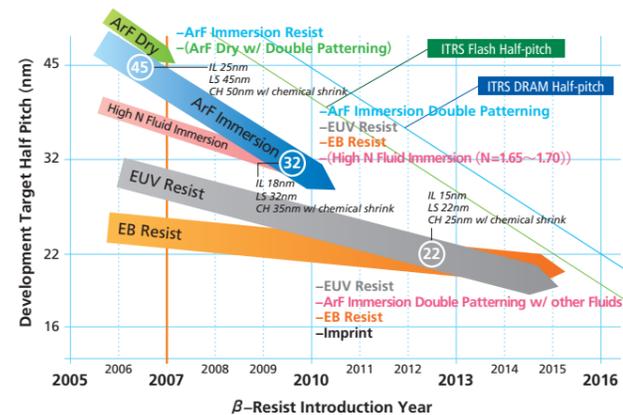
【半導体製造分野】主な製品の重点施策

- KrFエキシマレーザー用フォトレジストのさらなるシェア向上
- ArFエキシマレーザー用フォトレジストの改良
- 液浸露光対応プロセス材料の開発(トップコート材料等)
- 多層プロセス(Bi-Layer, Tri-Layer)用材料の提案
- 二重露光技術用材料の提案

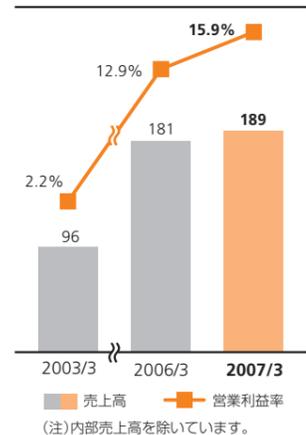
【FPD製造分野】主な製品の重点施策

- 液晶TFTアレイ用フォトレジストの微細化への対応
- 液晶カラーフィルター用ブラックレジストの高性能化・微細化対応

半導体用フォトレジストの開発ロードマップ



装置事業の業績推移(連結) (億円)



装置事業

装置事業では、液晶カラーフィルター用塗布装置の収益力向上を図るとともに、微細加工技術の新規用途の開拓にも取り組んでいます。

主な製品の重点施策

- 液晶カラーフィルター用塗布装置(コーター)におけるスピンコーターからノンスピンコーターへの買い替え需要の捕捉
- 半導体、半導体パッケージ/実装、MEMS分野等でのマーケティング(材料事業とのシナジー効果が期待できる「ポスト・コーター」事業の創出)

2. グローバル市場でのTOKブランドの確立

—微細加工技術分野のリーダーとして



「TOKブランド」の確立に向けて

技術開発のスピードとタイミングの重要性が増している中、市場のニーズをいち早くかつ広範に捉えることがアドバンテージにつながります。そうした状況においてグローバル市場で存在感を示すためには、「TOKブランド」の確立が鍵になります。

当社グループにとってブランドとは「顧客からの信頼感」という一言に集約され、このブランド力を向上させるということは、当社グループが提供する微細加工技術におけるソリューションに対して顧客からの期待を高め、競合他社に先んじて顧客からのニーズが自然かつ必然的に集まる状況を作り出すことを意味します。「微細加工ならTOK」というブランドが、企業価値拡大のポテンシャルを最大限に引き出すドライバーとして大きな役割を果たすと確信しています。

“モノづくり”の原点へ

最先端製品を安定的かつ低価格で量産化し得る製造技術の開発に取り組み、当社グループの原点である“モノづくり”に対する体制をより強固なものとする中で、“物にものを言わせるモノづくり”を具現化し、顧客満足度の向上を目指しています。

設計・開発、品質、サービス、価格のすべての面で優れた製品を供給するため、MES (Manufacturing Execution System: 製造実施システム)の導入、情報システムの活用等を進めています。また、ユーザーニーズが高度化・多様化する中、品質管理・品質保証体制のさらなる強化に向けて、半導体およびFPD製造分野でそれぞれ専用の研究開発棟を新設しました。

優れた製品を提供し続け実績を積み重ねていくことが、「TOKブランド」の確立につながるものと考えています。

海外拠点の充実

微細加工技術分野において確固たる地位を築き、グローバル市場においてリーダーシップを発揮していくため、顧客に密着したサポート体制の構築を北米、欧州、アジアの各地域で推進しています。当社を核にグループ内子会社との連携を密にし効率的に機能させることで、顧客からの信頼を勝ち取り、グローバル市場で「TOKブランド」の確立を実現していきます。

今後市場の拡大が期待される中国では、2005年8月に合併会社CHANG CHUN TOK (CHANGSHU) CO., LTD.で半導体・液晶ディスプレイ製造用高純度化学薬品の商業生産を開始し、その後生産品目を拡充するなど生産体制を整備してきました。また、韓国でも、2006年10月に合併会社COTEM CO., LTD.による液晶TFTアレイ用フォトレジストの現地生産を開始しています。さらに、2007年4月から当社執行役員を米国子会社TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.の社長として現地に常駐させ、米国市場における販売体制の強化を図っています。



CHANG CHUN TOK (CHANGSHU) CO., LTD.

3.

経営体質の強化・企業風土改革

— 誠実な企業であるために

取締役・取締役会

取締役会は、2007年6月28日現在、取締役7名(うち、社外取締役1名)で構成されており、原則として取締役会を「代表取締役」と「取締役」の二層にフラット化し、取締役会に求められる「経営意思決定・経営監督」機能の発揮に適した体制としています。また、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年とする一方、取締役会の透明性を高めるとともに、監督機能の強化を図ることを目的として、社外取締役を1名選任しています。

執行役員・執行役員会

取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実を図る一方、「業務執行」機能のさらなる強化に向け、各執行役員が担当する職務の責任領域・能力等を総合的に勘案して、「執行役員社長」以下、「専務執行役員」「常務執行役員」「執行役員」等の階層的な役位を設定するとともに、全執行役員で構成する「執行役員会」を設置しています。

2007年6月28日現在、執行役員は13名となっています。

監査役・監査役会

監査役会は、2007年6月28日現在、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されており、各監査役は、監査役会が定めた監査基準(監査役監査規程)に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受けるなどして、取締役の職務執行を監査しています。また、会計に関する事項につきましては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しています。

監査室

内部統制の一環として、4名の専任スタッフで構成される監査室を設置しており、定期的に必要内部監査を実施し、法令や社内規程等の遵守状況の調査と指導を行っています。

「経営体質の強化・企業風土改革」に向けて

事業のグローバル化に対応し、また、ステークホルダーの多様な要請に応えるべく、「CSR経営の推進」に取り組むとともに、「内部統制システムの構築」「ITシステムの有効活用」等にも注力し、「経営体質の強化」に努めています。

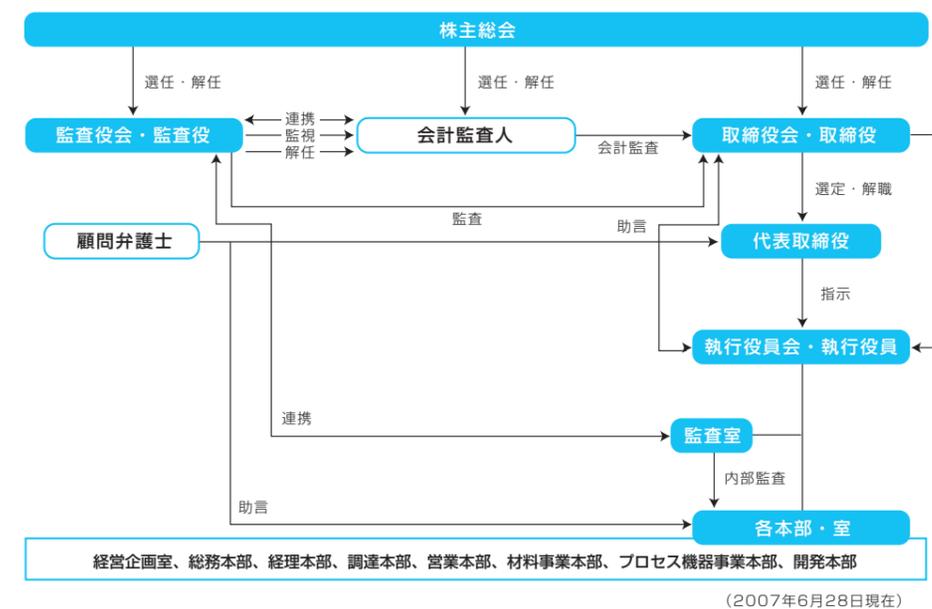
また、「企業風土改革」につきましても、役職員一人ひとりが「TOKブランド」の担い手であるという意識を持ち、「モノづくり」の土台となる現場力を向上させ、全社一丸となって激変する事業環境に順応できる企業風土の醸成を図っています。

コーポレート・ガバナンス

ステークホルダーの皆様からより高い信頼と満足を寄せられる企業を目指し、経営の透明性、健全性ならびに意思決定の迅速化等による効率性の確保を目的としたコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題の1つと位置づけ、その達成に向けて取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、監査役設置会社として引き続き監査役制度を採用しています。これは会社法において権限の強化が図られている監査役による監査の充実を図る一方で、取締役会の改革と2003年に導入した執行役員制度の定着により、「経営意思決定・経営監督」および「業務執行」の各機能の強化と責任の明確化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断しているためです。



環境・社会報告書 2007

CSR経営の推進

当社グループは、市場のニーズを的確に捉えた研究開発を積極的に行い、優れた製品の供給を通じて、企業として成長するとともに、広く社会の進歩・発展に貢献していくことが使命だと考えています。しかし、その過程においてCorporate Citizen(企業市民)の精神が欠けていては正しい事業活動とは言えないという認識に基づき、化学物質を多く取り扱う企業として、環境や健康に最大限の注意を払い、リデュース・リユース・リサイクルの「3R活動」の推進、化学物質の安全管理の徹底、省エネルギーの推進等の環境保全活動に取り組んでいます。また、コンプライアンス、リスクマネジメント等の体制を構築する一方、人材の育成に努め、従業員にとって働きやすい職場環境の整備にも力を入れています。

社会の一員として、環境、社会、経済の側面を総合的に捉え、全役職員が常にCSRを念頭に置いた事業活動を展開することで、ステークホルダーの皆様から高い信頼と満足を寄せられる企業であり続けるよう取り組んでいます。

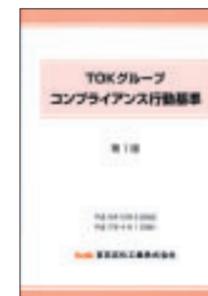
なお、詳細につきましては、毎年発行している「環境・社会報告書」において、当社グループの取り組みを報告しています。

コンプライアンス

全役職員一人ひとりのコンプライアンスに対する意識向上を図るとともに、共有する価値観と行動規範を明確にすることを目的として、「TOKグループ・コンプライアンス行動基準」を制定し、2005年4月1日より施行しています。

さらに、同行動基準の施行に合わせて、法令・行動基準違反等の事実の早期発見・解決を図るため、内部通報制度を整備し運用しています。内部通報制度につきましては、通報者保護のため、社内ルートに加え、当社顧問弁護士への通報ルート(社外ルート)を設けることにより、状況に応じて通報先を選択できるよう便宜を図るとともに、内部通報した際には、不誠実かつ不当な目的で行った場合を除き、これを理由として解雇その他不利益な扱いをしない方針を明確にしています。

なお、法令・行動基準違反等の事例が生じた場合は、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」において調査・検証を行ったうえで、必要に応じて適切な処分を下すこととしています。併せて、以後同様の事例が生じることのないよう、再発防止策を決定し、社内周知徹底させることとしています。



コンプライアンス行動基準

リスクマネジメント

企業経営に重大な影響を及ぼす様々な危機に対処するため、危機(リスク)の未然防止の徹底と緊急事態発生時のリスク軽減を図る体制を整えています。

「危機管理マニュアル」を制定し、総務本部長を委員長とする危機管理委員会を設置するとともに、広報部長を事務局長とする危機管理事務局を置き、危機の事前予知、予防措置および未然防止策の確立とそれらの社内への徹底を図り、また、危機が発生した際の対応を事前に定めています。



危機管理マニュアル

6年間の要約財務データ

東京応化工業株式会社および連結子会社

2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年の3月31日に終了した各会計年度

(百万円)

会計年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007
売上高	73,297	72,286	83,121	88,960	98,514	101,955
材料事業	54,903	62,721	66,927	71,617	80,338	83,038
装置事業	18,559	9,644	16,263	17,461	18,252	18,991
営業利益	2,618	4,563	5,703	7,295	10,544	10,884
税金等調整前当期純利益	2,601	3,885	8,372	8,070	11,324	11,119
当期純利益	1,314	1,924	4,751	5,088	6,656	6,660
設備投資額	7,670	8,019	4,131	3,631	6,962	8,531
減価償却費	5,031	5,232	5,810	5,595	5,502	5,931
研究開発費	5,803	6,028	6,744	5,800	5,683	6,487

1株当たり情報 (円)

1株当たり当期純利益	26.28	39.12	98.69	109.16	142.34	142.37
1株当たり配当金	20.00	20.00	22.00	27.00	33.00	36.00
1株当たり純資産	2,271.09	2,290.90	2,401.31	2,492.60	2,650.50	2,750.81

会計年度末

総資産	135,582	141,402	146,376	154,309	165,681	166,610
固定負債	7,416	7,954	6,564	7,086	2,222	2,108
純資産	113,126	111,241	111,301	115,564	123,915	131,074

指標

売上高研究開発費比率 (%)	7.9	8.3	8.1	6.5	5.8	6.4
売上高営業利益率 (%)	3.6	6.3	6.9	8.2	10.7	10.7
自己資本当期純利益率 (%)	1.2	1.7	4.3	4.5	5.6	5.3
自己資本比率 (%)	83.4	78.7	76.0	74.9	74.8	77.3

(注) 1. セグメント間の取引は、相殺消去していません。

2. 2006年3月期以前の純資産、1株当たり純資産、自己資本当期純利益率および自己資本比率は、それぞれの時点での株主資本、1株当たり株主資本、株主資本当期純利益率および株主資本比率を再計算せず、表示しています。

業績および財政状態の分析

業績の概況

売上高

当期(2007年3月期)の連結売上高は、前期比34億4千万円(3.5%)増加の1,019億55百万円となりました。このうち、上期の売上高は、前年同期比32億39百万円(6.8%)増加の506億97百万円、下期の売上高は、前年同期比2億円(0.4%)増加の512億57百万円となりました。

半導体市場が、デジタル家電や情報関連機器のほか、自動車等へ半導体の用途拡大が進み堅調に推移し、また、フラットパネルディスプレイ(FPD)市場においても、薄型テレビ等への需要拡大が見られたことから、増収を確保することができました。しかしながら、下期につきましては、特にFPD市場において生産調整の動きが急速に広がった影響等により、前年同期ならびに上期実績に対する伸長率は低位にとどまりました。

セグメント別分析

※セグメント間の取引は、相殺消去していません。

事業の種類別セグメント情報

当期における材料事業の売上高は、エレクトロニクス機能材料部門を中心に増加し、前期比27億円(3.4%)増加の830億38百万円となりました。また、装置事業の売上高は、前期比7億38百万円(4.0%)増加の189億91百万円となり、前期実績を上回る高い水準となりました。

【材料事業】

当事業は、主として「エレクトロニクス機能材料部門」「高純度化学薬品部門」および「印刷材料部門」により構成されています。

■エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料部門の売上高は、前期比35億16百万円(7.5%)増加の506億13百万円となりました。

半導体用フォトレジストは、半導体の用途拡大による需要増に加え、ユーザーニーズに対応した販売活動が奏功し、エキシマレーザー用フォトレジストを中心に実績を伸ばしました。

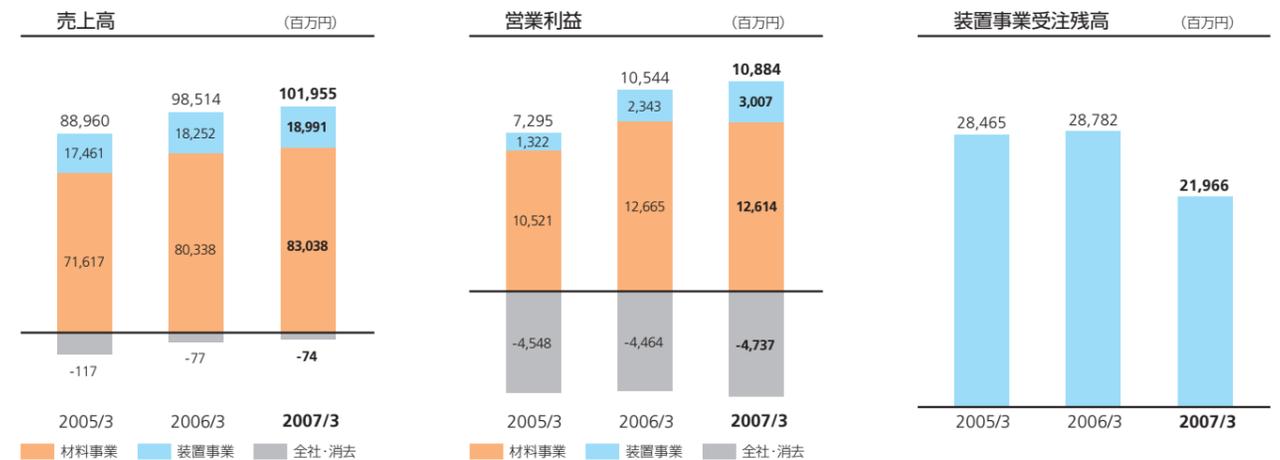
また、FPD用フォトレジストは、プラズマディスプレイ用フォトレジストがアジア地域で低調な経過を辿り前期を下回りましたが、液晶ディスプレイ用フォトレジストが価格下落や生産調整の影響を受けましたものの、高付加価値製品の販売拡大により前期を上回る実績をあげ、概ね堅調に推移しました。

一方、被膜形成用塗布液につきましては、アジア地域で実績を伸ばしましたが、国内需要の減退により売上は減少しました。

■高純度化学薬品部門

高純度化学薬品部門の売上高は、前期比9億37百万円(3.3%)減少の276億74百万円となりました。

無機化学品・有機化学品は、国内需要を的確に捉え実績を伸ばすことができたが、フォトレジスト付属薬品につきましては、製品価格の下落やFPD市場での生産調整の影響を受け売上は前期を下回りました。



■印刷材料部門

印刷材料部門の売上高は、前期比18百万円(0.4%)増加の46億1百万円となりました。

印刷用感光性樹脂版につきましては、フレキシ印刷向けが需要環境の変化等により厳しい展開を余儀なくされましたが、一般印刷向けは海外市場での拡販努力が奏功し実績を伸ばすことができました。

【装置事業】

当事業は、「プロセス機器部門」により構成されています。

■プロセス機器部門

プロセス機器部門の売上高は、前期比7億38百万円(4.0%)増加の189億91百万円となりました。

液晶パネル製造装置は、出荷済み製品の検収促進に努めたことにより売上は前期を上回ることができました。また、半導体製造装置につきましては低調に推移しました。

同部門の受注高は、液晶パネルメーカーにおける設備投資抑制の影響から、前期比34.7%減少の120億79百万円となりました。また、期末時点での受注残高は、前期末比23.7%減少しましたが、219億66百万円と引き続き高い水準にあります。

所在地別セグメント情報

■日本

デジタル家電やIT関連機器等の需要拡大に支えられ、エキシマレーザー用フォトレジストを中心に材料事業の売上は増

加しました。また、装置事業でも液晶パネル製造装置の売上が増加したことにより、売上高は前期比27億1千万円(3.2%)増加の861億48百万円となりました。利益面では、売上高の増加等により、営業利益は前期比4億46百万円(4.9%)増加の96億27百万円となりました。

■北米

エキシマレーザー用フォトレジストおよびフォトレジスト付属薬品の売上増加等により、売上高は前期比19億4百万円(24.3%)増加の97億37百万円となりました。利益面では、売上高の増加等により、営業利益は前期比5億4百万円(2.5倍)増加の8億4千万円となりました。

■欧州

フレキシ印刷用感光性樹脂版は、欧州市場での需要が低調に推移したことなどにより売上が減少したものの、エキシマレーザー用フォトレジストの売上増加等により、売上高は前期比10億84百万円(18.7%)増加の68億9千万円となりました。利益面では、売上高の増加等により、営業利益は前期26百万円の損失から当期8千万円の利益となりました。

■アジア

台湾子会社で液晶ディスプレイのカラーフィルター製造用フォトレジストが大幅に売上を伸ばしたものの、フォトレジスト付属薬品の販売が低調に推移したことなどにより、売上高は前期実績と同水準(前期比0.1%増加)の124億2百万円となりました。利益面では、販売価格の下落等により、営業利益は前期比4億49百万円(22.0%)減少の15億89百万円となりました。

売上原価・販売費及び一般管理費・営業利益

当期の売上原価は、前期比35億63百万円(5.4%)増加の692億48百万円となりました。売上原価率は、販売価格の下落等により、1.2ポイント上昇して67.9%となりました。しかしながら、エレクトロニクス機能材料部門を中心とした材料事業の売上の伸長と装置事業の売上の増加により、当期の売上総利益は、前期比1億22百万円(0.4%)の減少にとどまり、327億6百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、特許等使用料、保管・運送費の減少等により、前期比4億61百万円(2.1%)減少の218億22百万円となりました。

営業利益は、売上総利益の減少にもかかわらず、増収効果や販売費及び一般管理費の減少等により、前期比3億39百万円(3.2%)増加の108億84百万円、売上高営業利益率は、前期と同水準の10.7%となりました。

経常利益・税金等調整前当期純利益・当期純利益

経常利益は、損害補償料等の増加はありましたものの、営業利益の増加に加えて受取技術援助料や受取保険金等の増加により、前期比5億2千万円(4.7%)増加の116億77百万円となりました。これに伴い、売上高経常利益率は、前期比0.2ポイント上昇の11.5%となりました。

税金等調整前当期純利益は、固定資産除却損の増加等により、前期比2億4百万円(1.8%)減少の111億19百万円となりましたが、当期純利益につきましては、少数株主利益の減少等により、前期比3百万円(0.1%)増加の66億6千万円、売上高当期純利益率は、前期比0.3ポイント低下の6.5%となりました。

財政状態

財政状態

当期末(2007年3月31日)現在の資産合計は、前期末比9億29百万円増加の1,666億1千万円となりました。

流動資産は、前期末比61億19百万円減少の1,001億47百万円となりました。これは、増収や当期の末日が金融機関の休日であったことなどにより受取手形及び売掛金が

17億9百万円増加したものの、長期性預金への預入れ等により現金及び預金が66億79百万円、装置事業の製品在庫の減少等によりたな卸資産が15億7百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。

固定資産は、前期末比70億48百万円増加の664億63百万円となりました。これは、株式の時価下落等により投資有価証券が7億71百万円減少しましたが、相模事業所における研究開発用機械装置等への設備投資の増加により有形固定資産が33億24百万円、現金及び預金からの振替えにより長期性預金が50億円、それぞれ増加したことが主な要因であります。

当期末の負債合計は、前期末比42億4百万円減少の355億35百万円となりました。これは、装置事業の支払債務の減少等により支払手形及び買掛金が14億43百万円、前期末の法人税の支払い等により未払法人税が21億22百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。

当期末の純資産合計は、当期純利益66億6千万円等により、1,310億74百万円となりました。

この結果、当期末の自己資本比率は77.3%となりました。

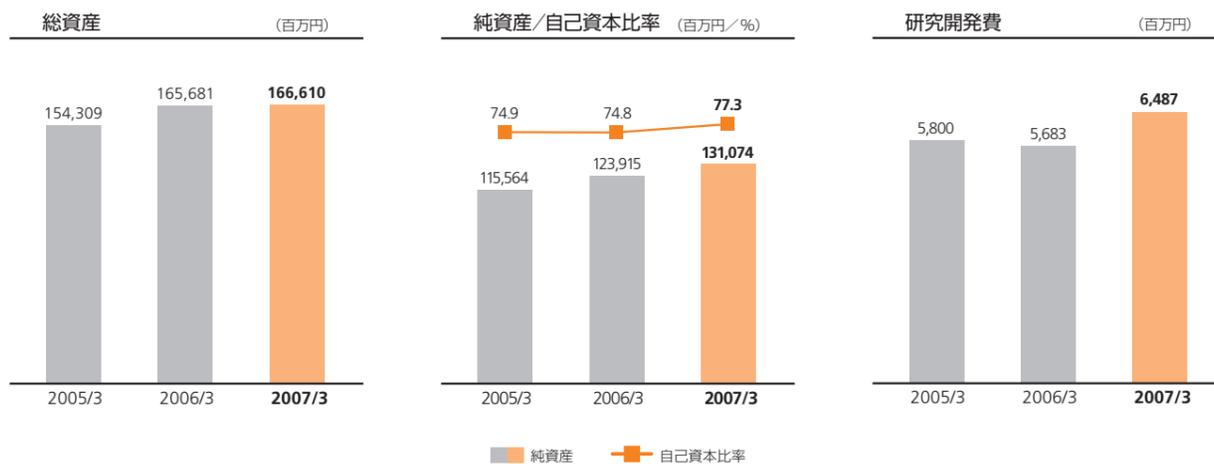
キャッシュ・フロー

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比7億36百万円増加の87億44百万円の資金収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益、減価償却費の増加やたな卸資産の減少等により資金収入が増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比20億16百万円増加の158億22百万円の支出となりました。これは、期中における研究開発設備等の有形固定資産の取得による支出や長期性預金の預入れによる支出等が増加したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比8億73百万円増加の14億69百万円の支出となりました。これは、配当金の支払額等が増加したことによるものです。

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比82億5千万円減少の325億69百万円となりました。



連結貸借対照表

2006年および2007年3月31日現在

(百万円)

区 分	2006		2007		構成比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	44,108		37,429		
受取手形及び売掛金	29,420		31,130		
たな卸資産	29,556		28,048		
繰延税金資産	2,035		1,918		
その他	1,279		1,725		
貸倒引当金	△134		△105		
流動資産合計	106,266	64.1	100,147	60.1	
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	54,311		55,910		
減価償却累計額	33,495	20,816	35,027	20,883	
機械装置及び運搬具	40,018		44,120		
減価償却累計額	33,402	6,615	34,128	9,991	
工具器具備品	14,045		15,659		
減価償却累計額	11,045	3,000	11,809	3,849	
土地		9,422		9,475	
建設仮勘定		2,796		1,776	
有形固定資産合計	42,652	25.8	45,976	27.6	
無形固定資産	2,023	1.2	1,596	1.0	
投資その他の資産					
投資有価証券	8,199		7,427		
長期貸付金	16		17		
繰延税金資産	703		953		
長期性預金	5,000		10,000		
その他	830		503		
貸倒引当金	△9		△10		
投資その他の資産合計	14,739	8.9	18,890	11.3	
固定資産合計	59,415	35.9	66,463	39.9	
資産合計	165,681	100.0	166,610	100.0	

(百万円)

区 分	2006		2007		構成比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	11,463		10,019		
未払金	5,171		5,121		
未払法人税等	3,224		1,101		
繰延税金負債	196		62		
未払消費税等	28		—		
前受金	12,604		12,904		
賞与引当金	1,538		1,731		
役員賞与引当金	—		20		
製品保証引当金	125		126		
その他	3,166		2,339		
流動負債合計	37,518	22.7	33,427	20.0	
固定負債					
長期借入金	5		220		
繰延税金負債	432		568		
退職給付引当金	1,213		1,113		
役員退職慰労引当金	536		174		
その他	34		31		
固定負債合計	2,222	1.3	2,108	1.3	
負債合計	39,740	24.0	35,535	21.3	
(少数株主持分)					
少数株主持分	2,025	1.2	—	—	
(資本の部)					
資本金	14,640	8.8	—	—	
資本剰余金	15,223	9.2	—	—	
利益剰余金	91,529	55.2	—	—	
その他有価証券評価差額金	3,660	2.2	—	—	
為替換算調整勘定	445	0.3	—	—	
自己株式	△1,583	△0.9	—	—	
資本合計	123,915	74.8	—	—	
負債、少数株主持分及び資本合計	165,681	100.0	—	—	
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	—	—	14,640	8.8	
資本剰余金	—	—	15,226	9.1	
利益剰余金	—	—	96,472	57.9	
自己株式	—	—	△1,414	△0.8	
株主資本合計	—	—	124,925	75.0	
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	—	—	3,104	1.8	
為替換算調整勘定	—	—	794	0.5	
評価・換算差額等合計	—	—	3,899	2.3	
少数株主持分	—	—	2,249	1.4	
純資産合計	—	—	131,074	78.7	
負債純資産合計	—	—	166,610	100.0	

連結損益計算書

2006年および2007年3月31日に終了した会計年度

(百万円)

区 分	2006		2007	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
売上高	98,514	100.0	101,955	100.0
売上原価	65,684	66.7	69,248	67.9
売上総利益	32,829	33.3	32,706	32.1
販売費及び一般管理費	22,284	22.6	21,822	21.4
営業利益	10,544	10.7	10,884	10.7
営業外収益				
受取利息	50		123	
受取配当金	66		84	
為替差益	320		—	
受取技術援助料	133		226	
受取保険金等	164		522	
特許等使用料返還益	—		167	
その他	180	0.9	273	1.4
営業外費用				
支払利息	12		14	
たな卸資産廃棄損	131		75	
損害補償料	99		431	
その他	61	0.3	83	0.6
経常利益	11,156	11.3	11,677	11.5
特別利益				
貸倒引当金戻入額	1		29	
受取補償金	400		—	
固定資産売却益	—		33	
その他	2	0.4	—	0.0
特別損失				
固定資産売却損	33		—	
固定資産除却損	202	0.2	620	0.6
税金等調整前当期純利益	11,324	11.5	11,119	10.9
法人税、住民税及び事業税	4,643		3,921	
法人税等調整額	△444	4.2	230	4.1
少数株主利益	467	0.5	307	0.3
当期純利益	6,656	6.8	6,660	6.5

連結株主資本等変動計算書

2007年3月31日に終了した会計年度

(百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2006年3月31日残高	14,640	15,223	91,529	△1,583	119,809
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(注)			△841		△841
剰余金の配当			△841		△841
役員賞与(注)			△33		△33
当期純利益			6,660		6,660
自己株式の取得				△4	△4
自己株式の処分		3		173	176
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	3	4,943	168	5,115
2007年3月31日残高	14,640	15,226	96,472	△1,414	124,925

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
2006年3月31日残高	3,660	445	4,105	2,025	125,940
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(注)					△841
剰余金の配当					△841
役員賞与(注)					△33
当期純利益					6,660
自己株式の取得					△4
自己株式の処分					176
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△555	349	△206	224	18
連結会計年度中の変動額合計	△555	349	△206	224	5,134
2007年3月31日残高	3,104	794	3,899	2,249	131,074

(注) 2006年6月開催の定時株主総会における利益処分項目です。

連結キャッシュ・フロー計算書

2006年および2007年3月31日に終了した会計年度

(百万円)

区 分	2006	2007
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	11,324	11,119
減価償却費	5,502	5,931
貸倒引当金の増減額 (減少額は△)	33	△29
賞与引当金の増加額	57	193
役員賞与引当金の増加額	—	20
製品保証引当金の増加額	41	1
退職給付引当金の減少額	△4,860	△107
役員退職慰労引当金の増減額 (減少額は△)	20	△362
受取利息及び受取配当金	△117	△207
支払利息	12	14
為替差益	△226	△431
受取補償金	△400	—
固定資産売却益	—	△33
固定資産売却損	33	—
固定資産除却損	202	620
売上債権の増加額	△2,961	△1,414
たな卸資産の増減額 (増加額は△)	△2,204	1,662
仕入債務の増減額 (減少額は△)	1,704	△1,495
未払消費税等の増加額	13	—
前受金の増加額	755	300
役員賞与の支払額	△30	△33
その他	1,547	△1,110
小計	10,449	14,636
利息及び配当金の受取額	117	196
関税還付金の受取額	7	—
補償金の受取額	400	—
利息の支払額	△12	△13
法人税等の支払額	△2,952	△6,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,008	8,744
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額	△2,499	△1,568
有形固定資産の取得による支出	△5,558	△8,904
無形固定資産の取得による支出	△443	△144
投資有価証券の取得による支出	△176	△193
長期性預金の預入による支出	△5,000	△5,000
その他	△127	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,805	△15,822
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	215
長期借入金の返済による支出	△1	△0
配当金の支払額	△1,393	△1,679
少数株主への配当金の支払額	△105	△146
自己株式の売却による収入	730	176
少数株主への株式の発行等による収入	194	—
その他	△19	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△595	△1,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	460	295
現金及び現金同等物の減少額	△5,931	△8,250
現金及び現金同等物の期首残高	46,752	40,820
現金及び現金同等物の期末残高	40,820	32,569



ホームページ上のIR情報

- 株主・投資家の皆様へ
 - 動画配信
 - 機関投資家・アナリスト向け決算説明会、
 - 会社案内ビデオ (日本語、英語、中国語、韓国語)
 - 株式情報
 - 株式の状況、株価情報、配当金の推移
 - IRカレンダー
 - 財務データ
 - 業績の概要推移、決算短信、四半期財務・業績の概況等
 - IRライブラリ
 - アニュアルレポート、報告書、有価証券報告書、説明会資料等
 - 株式に関するお手続き
 - 電子公告
 - 今日の株価
 - FAQ (よくあるご質問)
 - IRお問い合わせ窓口



<http://www.tok.co.jp/>



IR情報



私たちの仕事



会社概要 (2007年3月31日現在)

社名： 東京応化工業株式会社
 設立： 1940年10月25日
 本社： 〒211-0012
 川崎市中原区中丸子150
 従業員数： 1,816名(連結)
 資本金： 146億4,044万8千円
 ホームページ： <http://www.tok.co.jp/>
 上場証券取引所： 東京証券取引所市場第一部
 お問い合わせ先： 広報部
 〒211-0012
 川崎市中原区中丸子150
 TEL.044-435-3000
 FAX.044-435-3020

役員一覧 (2007年6月28日現在)

取締役

代表取締役 取締役社長	執行役員社長	中村 洋一	
代表取締役	専務執行役員	小峰 孝	開発本部長
代表取締役	専務執行役員	開発 宏一	総務本部長
取締役	常務執行役員	逸見 至保	経理本部長
取締役	執行役員	任田 博行	材料事業本部長
取締役	執行役員	岩崎 光文	営業本部長
取締役		牧野 二郎*	株式会社牧野フライス製作所取締役社長

監査役

常勤監査役	木谷 佳夫	
監査役	檜垣不二夫*	菱進ホールディングス株式会社取締役社長
監査役	羽山 幸男*	

執行役員

常務執行役員	堀越 昭則	経営企画室長
執行役員	古谷 仁	調達本部長
執行役員	小原 秀克	プロセス機器事業本部長
執行役員	大田 勝行	営業本部副本部長
執行役員	浅羽 洋	材料事業本部副本部長兼電子材料事業部長
執行役員	田澤 賢二	TOKYO OHKA KOGYO EUROPE B.V.取締役社長
執行役員	駒野 博司	TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.取締役社長

* 取締役 牧野二郎氏は、社外取締役であります。
 * 監査役 檜垣不二夫および監査役 羽山幸男の両氏は、社外監査役であります。

株式の状況

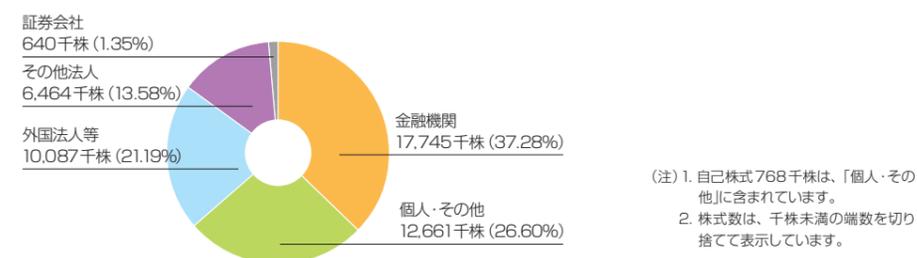
発行可能株式総数： 197,000,000株
 発行済株式の総数： 47,600,000株 (自己株式768,362株を含む)
 株主数： 11,230名

大株主(上位10名)

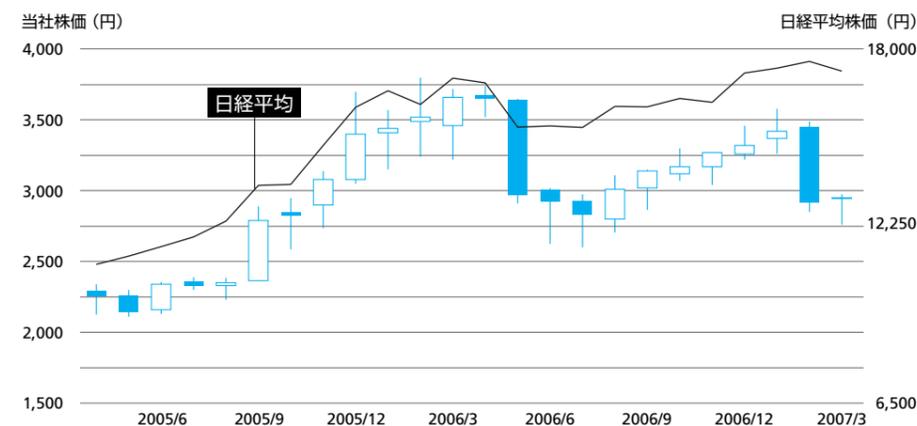
株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,630	7.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,631	5.61
明治安田生命保険相互会社	2,148	4.58
本多良子	1,494	3.19
株式会社横浜銀行	1,283	2.74
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,207	2.57
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019	1,204	2.57
財団法人東京応化科学技術振興財団	984	2.10
三菱UFJ信託銀行株式会社	953	2.03
伊藤毅雄	900	1.92

(注) 出資比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(46,831,638株)を基準に算出するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

所有者別株式分布状況



株価の推移



将来見通しに関する注意事項
 本アニュアルレポートに記載の将来に対する見通し、予想等につきましては、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがって、実際の業績は様々な重要な要因により、この業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があるため、この業績見通しに全面的に依拠されませんよう、お願いいたします。また、その時点以降に修正されている場合があるため、最新の資料をご入手いただくなど、必ずご確認いただきますよう、お願いいたします。

tok 東京応化工業株式会社

〒211-0012 川崎市中原区中丸子150

TEL.044-435-3000 (代表)

FAX.044-435-3020

<http://www.tok.co.jp/>



環境に配慮した大豆油インキを使用しています。

07.08 500 NIR. AUMZ